LABORATORIA APARATURA BADANIA

ISSN-1427-5619

2/2018



DWUMIESTECZNIK

Badania własności optycznych cienkich warstw

Zalety prowadzenia projektów w laboratorium

Spektroskopia UV-Vis (Ultraviolet/ Visible Spectroscopy)

cienkich warstw

Spektroskopia UV-Vis jest rodzajem spektroskopii świetlnej wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie bliskiego ultrafioletu UV oraz światła widzialnego Vis, czyli w zakresie 200-800 nm. Widmo UV/VIS nazywane jest również widmem elektronowym absorpcyjnym. Z uwagi na to, że sumaryczna energia cząsteczki złożona jest z energii elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej, w rzeczywistości jest widmem elektronowo--oscylacyjno-rotacyjnym. W przypadku materiałów organicznych absorpcja promieniowania w przedziale UV/Vis powoduje zmiany energetycznych stanów elektronów walencyjnych, co wpływa na transfer elektronu z atomowego orbitalu na orbital o wyższej energii. Wyróżnia się przy tym przejścia związane z transferem elektronów wiązań pojedynczych σ , wielokrotnych π oraz elektrony wolnych par elektronowych n. Absorpcja promieniowania z zakresu UV--Vis występuje w przypadku związków organicznych zawierających grupy chromoforowe w pobliżu których możliwe jest występowanie przejść elektronowych ze stanu podstawowego na stan wzbudzony.

Pomiar absorbcji przy użyciu spektroskopii UV-Vis

Badania własności optycznych

Pomiar widm absorpcji wykonywany jest przy użyciu spektrofotometru UV-Vis, umożliwiającego rejestrowanie widm - w zależności od konstrukcji urządzenia – w zakresie od bliskiego nadfioletu, przez zakres światła widzialnego do bliskiej podczerwieni w zakresie długości fal od 200 do 1000 nm. Podczas badania określa się przedział absorpcji charakterystyczny dla danego materiału. Dla ułatwienia analizy przedział absorpcji podaje się w skali obejmującej długość absorbowanej fali lub wartości długości fali, które przelicza się na energię fotonu za pomocą wzoru:

$$E = \frac{n \cdot c}{\lambda} \tag{1}$$

1.

h – stała Planca (6,626·10⁻³⁴ J·s), *c* – prędkość światła w próżni (299792458 m·s⁻¹),

 λ – długość fali w metrach.

qdzie:

Badania optyczne w zakresie UV-Vis służą do wyznaczenia zmienności transmisji promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez badaną próbkę w funkcji długości fali. Transmisja *T* jest zdefiniowana zależnością:

$$T = \frac{I}{I_0}$$
 gdzie:

(2)

I₀ – intensywność wiązki padającej, *I* – intensywność wiązki po przejściu przez badaną warstwę materiału,

T – transmisja, malejąca wrazz grubością warstwy, zgodniez zależnością:

$$T = exp(-\alpha d) \tag{3}$$

gdzie:

α – współczynnik absorpcji,

d – grubość warstwy.

W badaniach materiałów organicznych częściej wykorzystuje się absorbancję *A*, która jest zdefiniowana zależnością:

$$A = log(1/T)$$
 (4)

Z porównania wzorów (3) i (4) wynika, że

$$A=2,303 (\alpha d).$$
 (5)

Widma absorpcji w zakresie UV-Vis przedstawiają zmienność absorpcji padającej wiązki po przejściu przez badaną warstwę w funkcji długości fali. Wykorzystanie spektrofotometru UV-Vis umożliwia pomiar poziomu absorpcji cienkich warstw, np. warstw aktywnych blend MePc-PTC-DA stosowanych w ogniwach fotowoltaicznych.

W przypadku warstw stanowiących mieszaninę dwóch składników nie reagujących ze sobą, na podstawie rozkładu intensywności widm absorpcyjnych w badanym zakresie długości fal możliwe jest oszacowanie udziału składników mieszaniny. W tym przypadku intensywność absorpcji odzwierciedla udział składnika w warstwie, dlatego widmo mieszaniny może być traktowane jako suma widm składowych i obliczane ze wzoru:

$$I_{A-B} = a \cdot I_A + b \cdot I_B \quad \text{(6)}$$

gdzie:

Tomasz Tański, Wiktor Matysiak, Paweł Jarka*

a – udział składnika A,

b – udział składnika B,

*I*_A – wartość absorpcji składnika A,

 $I_{\rm B}$ – wartość absorpcji składnika B.

Przykładem możliwości oszacowania udziału poszczególnych składników mieszaniny jest szacowanie udziału materiałów organicznych PTCDA, NiPc przedstawione na rysunku 1.

Badanie szerokości przerwy energetycznej warstw przy użyciu badań absorbcyjnych

Zależność współczynnika absorpcji badanego materiału w funkcji energii padającego promieniowania na jego powierzchnię ma postać [1]:

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^{\rho}, \quad (7)$$

gdzie:

- α współczynnik absorpcji,
- h stała Plancka,

v – częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego,



Rys. 1. Widmo absorpcji cienkiej warstwy organicznej osadzonej z fazy gazowej jednoźródłowo o udziale procentowym 25% PTCDA oraz 75% NiPc

 $E_{\rm g}$ – szerokość przerwy energetycznej badanego materiału,

 A – stała uzależniona od prawdopodobieństwa przejść elektronów.

W przypadku współczynnika r podawane są różne wartości takie jak [2]: ½ i 3/2 w przypadku dostępnych i niedostępnych bezpośrednich przejść międzypasmowych oraz 2 i 3 dla kolejno dopuszczalnych i zabronionych przejść pośrednich. Najlepsze rezultaty osiągnięto jednak stosując wykładnik równy ½ [3,4] i taki przyjęto w tej pracy.

Jedną z metod pozwalających określić szerokości przerwy energetycznej przez określenie zależności pomiędzy współczynnikiem absorpcji α a energią fal elektromagnetycznych jest wykorzystanie analizy spektralnej UV-Vis. W celu przeprowadzenia badania należy dokonać pomiaru absorbancji ABS w funkcji długości fali λ ,

długości fali)

korzystając następnie z relacji między absorbancją *ABS* i transmitancją *T*:

$$ABS = -\log\left(T\right) \tag{8}$$

wyznaczyć widma zależności transmitancji w funkcji długości fali. Uwzględniając powyższe równie oraz zakładając,



Rys. 3. Widma UV-Vis zarejestrowane dla wytworzonego nanoproszku SiO₂, włóknistej maty polimerowej PVP oraz kompozytowej PVP/SiO2 (a); zależność (ahv)² w funkcji energii kwantu promieniowania wyznaczone na postawie widm UV-Vis dla wytworzonych materiałów wraz z dopasowanymi metodą najmniejszych kwadratów prostymi definiującymi miejsca zerowe funkcji liniowych odpowiadające wartością przerw energetycznych



Rys. 2. Zależność $(\alpha hv)^2$ w funkcji energii kwantu promieniowania; przykładowy wykres wraz z dopasowaniem pro-

stej otrzymany dla analizy UV-Vis (absorbancja w funkcji

rok 23, nr 2 LAS | 15

BADANIA

że zjawisko odbicia promieniowania zachodzące na granicy powietrze–próbka jest pomijalnie małe, równanie wyrażania na rzeczywistą i urojoną część przenikalności optycznej przybierają przybiera następującą postać: (9)

$$\left[h\nu\ln\left(\frac{1}{10^{-ABS}}\right)\right]^2 = B(h\nu - E_g)$$

gdzie:

B – stała uzależniona od prawdopodobieństwa przejść elektronów podzielona przez grubość badanej warstwy.

Następnie wykreśla się zależności w funkcji energii kwantów promieniowania dla wszystkich wytworzonych próbek i – analogicznie do pierwszej metody – dopasowuje się funkcje liniowe do prostoliniowych odcinków wykresów o największych współczynnikach kierunkowych prostej (Rys. 2). Miejsca zerowe, wyznaczone przez obliczenie wartości bezwzględnej stosunku wyrazów wolnych do współczynników kierunkowych dopasowanych prostych odpowiadają szerokością przerw energetycznych. Przykładem szacowania szerokości przerw energetycznych mogą być wyniki badań włókien kompozytowych i polimerowych przedstawione na rysunku 3.

Literatura

[1] M. Isik, N. Gasanly, Ellipsometry study of optical parameters of AgIn5S8 crystals, Physica B: Condensed Matter 478 (2015) 127–130.

[2] E.R. Shaaban, M. El-Hagary, M. Emam-Ismail, S.H. Moustafa, A. Adel, Optical characterization of polycrystalline ZnSe1– *x*Tex thin films using variable angle spectroscopic ellipsometry and spectrophotmetery techniques, Materials Science in Semiconductor Processing 39 (2015) 735–74. [3] J.S. Im, M.I. Kim, Y.S. Lee, Preparation of PAN - based electrospun nanofiber webs containing TiO2 for photocatalytic degradation, Materials Letters 62 (2008) 3652-3655.
[5] Z. Kleszczewski, Wybrane zagadnienia z optyki falowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

* Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

BazTech – kopalnia wiedzy

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 645 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.), a na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki.

BazTech	Scolar) President	Person O backs			Baza awartości polskich	i danych czasopism technicznych
Artybuty paneterapper shows hele wyr w desenform path w byda wirdd antorion w diwaich Shatosowych w cytowarch Shatosowych w cytowarch w pathor w pathor w pathor w pathor w pathoria	ademme ad sector of the secto	rola 🖉				Pedrovery Josef and RD states states Categorithe 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
		Barlach	Cikm	Otwarte	Vapor	

W bazie zamieszczone są również artykuły z archiwalnych numerów LAB.

Szukaj pod adresem: yadda.icm.edu.pl/baztech/